

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成17年11月10日(2005.11.10)

【公開番号】特開2003-183294(P2003-183294A)

【公開日】平成15年7月3日(2003.7.3)

【出願番号】特願2002-318109(P2002-318109)

【国際特許分類第7版】

C 07 F 9/32

C 09 K 21/12

【F I】

C 07 F 9/32

C 09 K 21/12

【手続補正書】

【提出日】平成17年9月26日(2005.9.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

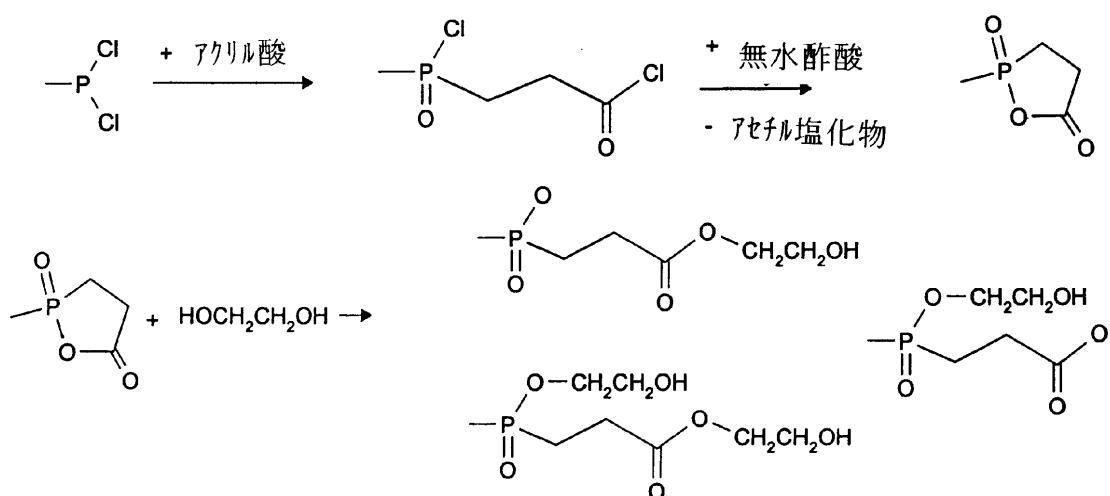
【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

【化2】



反応式図1：カルボキシエチルメチルホスフィン酸グリコールエステルの製造

(米国特許第4,062,888号明細書またはドイツ特許第2,529,731号明細書に従う)

ホスフィン酸エステルは、1-オレフィンに過酸化物触媒の存在下に亜ホスホン酸モノエステルを付加することによって得られる。しかしながらその収率は僅かなものでしかない。触媒としてのアルコキシドの存在下では、活性化二重結合への亜ホスホン酸モノエステルの付加反応はより良好に進行する。適する不飽和化合物は、-不飽和カルボン酸エステルまたは、-不飽和カルボン酸ニトリル、-不飽和ケトンおよびアルキルビニルスルホン類および酢酸ビニルがある(Houben-Weyl、第12/1巻、第258-259頁)。